

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載
 【部門区分】第 2 部門第 4 区分
 【発行日】平成 23 年 9 月 15 日 (2011.9.15)

【公表番号】特表 2009-544489 (P2009-544489A)
 【公表日】平成 21 年 12 月 17 日 (2009.12.17)
 【年通号数】公開・登録公報 2009-050
 【出願番号】特願 2009-520792 (P2009-520792)
 【国際特許分類】

B 4 1 J 2/05 (2006.01)

B 4 1 J 2/16 (2006.01)

【F I】

B 4 1 J 3/04 1 0 3 B

B 4 1 J 3/04 1 0 3 H

【手続補正書】
 【提出日】平成 22 年 7 月 6 日 (2010.7.6)
 【手続補正 1】
 【補正対象書類名】特許請求の範囲
 【補正対象項目名】全文
 【補正方法】変更
 【補正の内容】
 【特許請求の範囲】
 【請求項 1】

表面を有する多結晶シリコン基板であって、一部が液体チャネルを定める多結晶シリコン基板と、

該多結晶シリコン基板の前記表面に配置されたノズル板構造であって、一部がノズルを定め、該ノズルは、前記液体チャネルと流体連通される、ノズル板構造と、

該ノズル板構造と対応する液滴形成機構であって、制御可能に作動し、前記ノズルを通して流れる連続液体ストリームから、液滴を形成し、または前記ノズルに存在する液体から、オンデマンド式に液滴を放出する液滴形成機構と、

を有するプリントヘッド。

【請求項 2】

プリントヘッドを形成する方法であって、
 多結晶シリコン基板を提供するステップと、
 前記多結晶シリコン基板の表面で、処理プロセスを実施するステップと、
 前記多結晶シリコン基板の前記表面に、ノズル板構造を提供するステップと、
 前記ノズル板構造と対応する液滴形成機構を提供するステップと、
 を有する方法。

【請求項 3】

多結晶基板装置であって、

第 1 の結晶および第 2 の結晶を有する基板であって、前記第 1 の結晶は、前記第 2 の結晶の配向とは異なる配向を有する、基板と、

前記第 1 の結晶の少なくとも一部に配置された第 1 のホールと、

前記第 2 の結晶の少なくとも一部に配置された第 2 のホールと、

を有する多結晶基板装置。